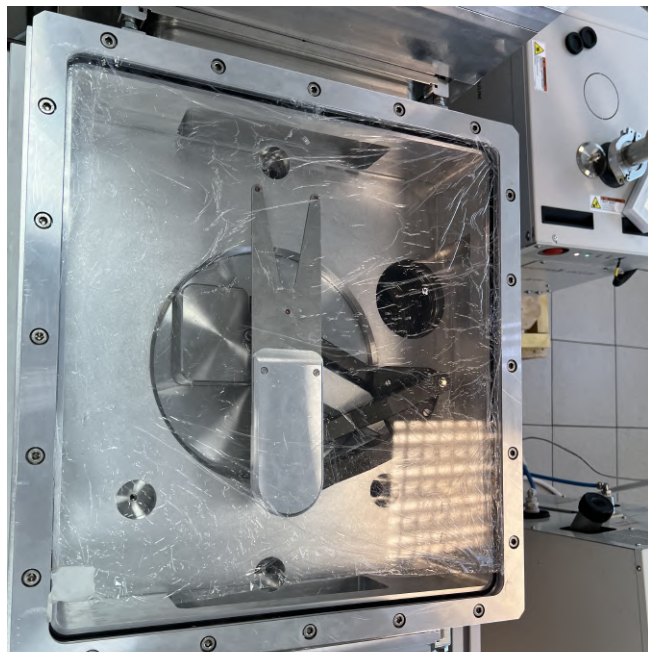


Плазма ТМ 200-04

Установка атомно-слоевого травления для бездефектного однородного
удаления нанослоев при формировании наноструктур



Технические характеристики:

Характеристика	Плазма ТМ 200-04
Скорость травления, А/мин	4
Мощность генератора, Вт	1000
Термостатированный рабочий стол, °С	от -20 до +60
Потребляемая мощность, кВт	19
Нагрев стенок реактора, °С	40-60
Равномерность травления (от края 3 мм), %	±5
Газовая система	В соответствии с требованиями заказчика

- Система загрузки: шлюзовая, шлюзовая из кассеты, SMIF-контейнер
- Обработка пластин Ø 76, 100, 150, 200, 300 мм
- Поддержание стабильного ВЧ-разряда в диапазоне рабочих давлений 1-10 Па
- Встраивание в кластерный комплекс
- Встраивание в чистую комнату
- Габариты (ШхГхВ) не более 1900x2850x2000 мм

